PAT-NO:

JP410193162A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 10193162 A

TITLE:

METHOD FOR REMOVING CONTAMINATED MATERIAL

PUBN-DATE:

July 28, 1998

INVENTOR-INFORMATION: NAME KOSHIKAWA, HIROSHI TERAI, HARUHIKO TAKIMOTO, MASAFUMI TATSUMI, JUNJI

IKEGAME, TAKESHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

CANON INC

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP09012029

APPL-DATE:

January 7, 1997

INT-CL (IPC): B23K026/18, B23K026/00

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To perfectly and surely remove a contaminated material by applying an energy transdusing medium on the contaminated material (by-product) stuck to a base material having water repellency or a base material subjected to water repellent treatment and irradiating it with a laser beam.

SOLUTION: In a base material 4 formed with a water repellent layer liquid 7, which contains a surface active agent as an energy transfusing medium, is coated on the surface stuck with a contaminated material 6 (by-product), a liquid 7 containing a surface active agent is irradiated with a laser beam, which is emitted from a YAG laser 1 through a SHG 2/ filter has a wave length having selective absorbability to be absorbed in the liquid 7, the energy transdusing medium is instantly evaporated or transdused kinetic energy, thus, the contaminated material is removed.

COPYRIGHT: (C) 1998, JPO

(19)日本国特新庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-193162

(43)公開日 平成10年(1998)7月28日

(51) Int.CL⁶

識別記号

B23K 26/18 26/00 FΙ

B 2 3 K 26/18 26/00

 \mathbf{E}

審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 4 頁)

(21)出願番号

特願平9-12029

(22)出顧日

平成9年(1997)1月7日

(71)出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 越川 浩志

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 寺井 晴彦

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 瀧本 雅文

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(74)代理人 弁理士 阪本 善朗

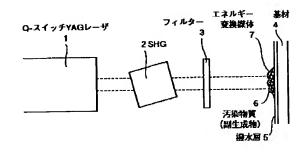
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 汚染物質の除去方法

(57)【要約】

【課題】 挽水性を有する基材あるいは表面に挽水処理 を施した基材に付着した汚染物質(副生成物)に対して エネルギー変換媒体を塗布して、レーザ光を照射するこ とによって、汚染物質を完全にかつ確実に除去する方法 を実現する。

【解決手段】 撓水層5を形成した基材4において、汚 染物質(副生成物) 6が付着した表面にエネルギー変換 媒体としての界面活性剤を含んだ液体7を塗布するとと もに、YAGレーザ1からSHG2およびフィルター3 を介して出射され、液体7には吸収される選択吸収性を 有する波長のレーザ光を界面活性剤を含んだ液体7に照 射させることにより、エネルギー変換媒体を瞬間的に蒸 発させあるいはレーザ光のエネルギーを運動エネルギー に変換させて、汚染物質を除去する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 汚染物質の付着した基材にエネルギー変 換媒体を塗布し、これにレーザ光を照射することによ り、エネルギー変換媒体を瞬間的に蒸発させ、あるいは 光エネルギーを運動エネルギーに変換させて、汚染物質 を除去する方法において、前記エネルギー変換媒体とし て界面活性剤を含んだ液体を使用することを特徴とする 汚染物質の除去方法。

1

【請求項2】 界面活性剤を含んだ液体は、レーザ光を 吸収するものであることを特徴とする請求項1記載の汚 10 染物質の除去方法。

【請求項3】 基材は、 挽水性を有する材質、 あるいは 表面に挩水処理を施した材質でできていることを特徴と する請求項1また2記載の汚染物質の除去方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、樹脂等にレーザ光 を照射して加工を行なうアブレーションや成膜、あるい はその他の加工によって樹脂等の表面に付着した汚染物 質(副生成物)をレーザの照射により除去する方法に関 20 するものである。

[0002]

【従来の技術】KrFエキシマレーザ等のレーザ光を樹 脂に照射して、アブレーション加工や成膜加工、あるい はその他の加工を行なう際に、樹脂材料を構成する分子 の分子間解離エネルギーよりも大きなエネルギーをもつ エキシマレーザ光によって、樹脂材料の分子が直接断ち 切られて分解除去され、所定の加工がなされているが、 このとき、分解除去された炭素や炭化物等は微小破片と なって飛散し、この微小破片は樹脂表面に落下堆積し付 30 着してしまう。このように樹脂の表面に付着した副生成 物はその表面を汚染し、好ましいものではない。

【0003】そこで、このような汚染物質(副生成物) を樹脂等の表面から除去する方法が従来から種々提案さ れている。それらの中において、レーザ光を用いて樹脂 等の基材の表面に付着した汚染物質を除去する方法とし て次のような方法が提案されている。

【0004】1.汚染物質に対して吸収性のあるレーザ 光を直接照射し、これを除去する方法(特開平5-42 385号公報)。

【0005】2.汚染物質とこれが付着した基材表面と の間に水の層を設け、この水の層にレーザ光のエネルギ ーを吸収させ、変換された運動エネルギーにより、ある いは水の層の爆発的な蒸発により、汚染物質を飛ばす方 法(米国特許第4987286号明細書)。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の 従来技術において、前者の従来技術では、後者の水のよ うなエネルギー変換媒体が存在しないために、汚染物質 を除去する力が弱く、ごく微細な汚染物質しか除去する

ことができないものであり、また、後者の従来技術で は、水をエネルギー変換媒体として用いているために、 除去効果は前者に比べて著しく改善されている。しか し、
・
飛水性を有する基材や表面に
・
飛水処理を施した基材 上では、水を弾いてしまい、水がエネルギー変換媒体と して満足に機能しないことがあった。

【0007】そこで、本発明は、上述の従来技術の有す る未解決な課題に鑑みてなされたものであって、汚染物 質の付着した基材にエネルギー変換媒体として界面活性 剤を含む液体を塗布してレーザ光を照射することによっ て、挠水性を有する基材や表面に挠水処理を施した基材 上であっても、汚染物質を完全にかつ確実に除去するこ とができる汚染物質の除去方法を提供することを目的と するものである。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明の汚染物質の除去方法は、汚染物質の付着し た基材にエネルギー変換媒体を塗布し、これにレーザ光 を照射することにより、エネルギー変換媒体を瞬間的に 蒸発させ、あるいは光エネルギーを運動エネルギーに変 換させて、汚染物質を除去する方法において、前記エネ ルギー変換媒体として界面活性剤を含んだ液体を使用す ることを特徴とする。

【0009】さらに、本発明の汚染物質の除去方法は、 界面活性剤を含んだ液体はレーザ光を吸収するものであ ることが好ましく、また、基材が発水性を有する材質あ るいは表面に飛水処理を施した材質であるときに特に好 適である。

[0010]

【作用】本発明において、樹脂等の基材にレーザ光を照 射して加工を行なうアブレーションや成膜、その他の加 工などによって表面に汚染物質(副生成物)の付着した 樹脂等の基材に、エネルギー変換媒体として界面活性剤 を含んだ液体を塗布し、これに選択吸収性を有する波長 のレーザ光を照射することにより、エネルギー変換媒体 を瞬間的に蒸発させあるいはレーザ光のエネルギーを運 動エネルギーに変換させて、汚染物質を除去するもので あって、基材が飛水性を有するものや飛水処理を施した ものであっても、エネルギー変換媒体としての界面活性 剤を含んだ液体が、撓水面上でも弾かれることなく汚染 物質を完全に覆いかつ汚染物質と焼水面の間に浸透する ことから効果的に機能して、汚染物質(副生成物)を完 全にかつ確実に除去できるものである。

[0011]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図面に基づ いて説明する。

【0012】図1の(a)および(b)は、 疣水処理を 施した基材に付着した汚染物質に対するエネルギー変換 媒体としての液体の作用を説明するための説明図であ

り、図2は、本発明にかかる汚染物質の除去方法の実施

例の一例を概略的に示す構成図である。

【0014】図1の(a) および(b) において、11 は撥水処理を施した基材、12は基材表面に付着した汚 染物質である。エネルギー変換媒体として界面活性剤を 含まない液体13を汚染物質12を覆うように基材11 に塗布した場合は、図1の (a) に示すように、液体1 3は撓水面上で弾かれてしまい、基材11と汚染物質1 2の間にうまく浸透しない。 したがって、 これにレーザ 光を照射しても汚染物質12を除去するだけのエネルギ ーを得ることができない。一方、エネルギー変換媒体と して界面活性剤を含んだ液体14を塗布した場合には、 図1の(b)に示すように、液体14に含まれる界面活 性剤の作用により、液体14は、撓水面上でも弾かれる ことなく、良好な濡れ性を示し、汚染物質を完全に覆う 20 ことができかつ汚染物質と廃水面の間にもよく浸透す る。したがって、後述するレーザ光を照射した際に、汚 染物質を完全に覆いかつ汚染物質と挽水面の間に浸透し た液体14によって、汚染物質を完全に除去できるだけ のエネルギーを生み出すことが可能となる。

【0016】次に、本発明の汚染物質の除去方法の実施例を図2に基づいて説明する。図2において、1はQ-スイッチ YAGレーザ、2は第2高調波発生器SHG (Second Harmonic Generator)、3はフィルター (Optical Filter)である。この構成により、Q-ス 40イッチ YAGレーザ1から発振されたレーザ光は、SHG2により基本波とその倍波の混合光となり、さらに、フィルター3によって基本波をカットして倍波のみを取り出して、この倍波を汚染物質6が付着した基材4に照射してその汚染物質6を除去しようとするものである。そして揺水層5が形成された基材4上の汚染物質6にはエネルギー変換媒体としての界面活性剤を含んだ液体7を塗布してある。

【0017】ここで、基材4は、その表面に挽水層5が 形成されたポリエーテルサルフォンのフィルムであっ

て、KrFエキシマレーザによるアブレーションによって微細加工を施したものであり、その際に発生した副生成物(汚染物質)6が飛水層5に付着する。このアブレーション加工の副生成物(汚染物質)6の付着は金属顕微鏡で確認できる。この副生成物(汚染物質)6を覆うように界面活性剤を含んだ液体(例えば、黒インク)7を塗布する。この界面活性剤を含んだ液体7は、その界面活性剤の作用により、飛水層5上でも弾かれることなく、良好な濡れ性を示し、汚染物質6を完全に覆うことができかつ汚染物質6と飛水層5の間にも浸透する。液体7として黒インクを例示したが、液体の色は光を吸収しやすい黒色が望ましいが、その他の色でもよい。

【0018】そして、副生成物 (汚染物質) 6が付着 し、これに界面活性剤を含んだ液体7として黒インクを 塗布したポリエーテルサルフォンのフィルム基材4に対 して、上述のようにフィルター3から出射されたレーザ 光の倍波を1~10パルス照射する。このとき照射した 倍波 (λ=532nm) はエネルギー密度が3.3mJ /puls-cm² であり、ポリエーテルサルフォンの フィルム4に入射した倍波は、ポリエーテルサルフォン には吸収のない波長のレーザ光であるが、界面活性剤を 含んだ液体7には吸収がある選択吸収性のある波長のレ ーザ光である。このため、この界面活性剤を含んだ液体 7がエネルギー変換媒体として機能し、レーザ光を吸収 して瞬間的に蒸発するなどして副生成物6を除去するこ とができる。予め金属顕微鏡により付着が確認された副 生成物 (汚染物質) の様子を再度金属顕微鏡で観察した ところ、副生成物(汚染物質)6は完全に除去されてい ることが確認できた。

【0019】以上のように、猊水性を有する樹脂や猊水 処理を施した樹脂等の基材にエキシマレーザ光の照射に よりアブレーションや成膜あるいはその他の加工などの 微細加工を行なうことによって、その表面に付着した汚 染物質(副生成物)に対して、エネルギー変換媒体とし ての界面活性剤を含んだ液体を塗布し、これに選択吸収 性を有する波長のレーザ光を照射することにより、エネ ルギー変換媒体を瞬間的に蒸発させ、あるいはレーザ光 のエネルギーを運動エネルギーに変換させて、汚染物質 とともに除去することができる。このように、基材が発 水性を有するものや飛水処理を施したものであっても、 エネルギー変換媒体としての界面活性剤を含んだ液体 が、その界面活性剤の作用により、挽水面上でも弾かれ ることなく、汚染物質を完全に覆いかつ汚染物質と挠水 面の間によく浸透するから、エネルギー変換媒体として 効果的に機能して、汚染物質(副生成物)を完全にかつ 確実に除去できる。

[0020]

【発明の効果】本発明は、上述したように、レーザ光を 樹脂に照射して加工を行なうアブレーションや成膜等の 加工によって汚染物質(副生成物)が付着した基材に、 5

エネルギー変換媒体として界面活性剤を含んだ液体を塗布し、これに選択吸収性を有する波長のレーザ光を照射することにより、エネルギー変換媒体としての界面活性剤を含んだ液体を瞬間的に蒸発させるなどして汚染物質を除去するものであって、基材が撹水性を有するのものあるいは表面に撹水処理を施したものであっても、エネルギー変換媒体としての界面活性剤を含んだ液体が、撹水面上で弾かれることなく、有効に機能し、汚染物質(副生成物)を完全にかつ確実に除去することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 脱水処理を施した基材に付着した汚染物質に対するエネルギー変換媒体としての液体の作用を説明するための説明図である。

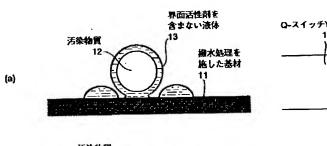
6 【図2】本発明の汚染物質の除去方法の実施例の一例を 概略的に示す構成図である。

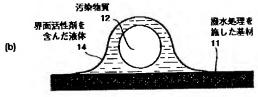
【符号の説明】

- 1 Q-スイッチ YAGレーザ
- 2 第2高調波発生器SHG
- 3 フィルター
- 4 基材
- 5 擦水層
- 6 汚染物質(副生成物)
- 10 7 界面活性剤を含んだ液体(エネルギー変換媒体)

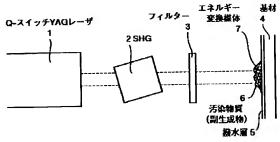
 - 12 汚染物質
 - 13 界面活性剤を含まない液体
 - 14 界面活性剤を含んだ液体

【図1】





【図2】



フロントページの続き

(72) 発明者 巽 純二

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内 (72) 発明者 池亀 健

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内